

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年10月6日(2005.10.6)

【公開番号】特開2003-163201(P2003-163201A)

【公開日】平成15年6月6日(2003.6.6)

【出願番号】特願2002-263201(P2002-263201)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/3065

// H 05 H 1/46

【F I】

H 01 L 21/302 101 H

H 05 H 1/46 A

【手続補正書】

【提出日】平成17年5月27日(2005.5.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

真空処理室と、プラズマ発生装置と、前記真空処理室に処理ガスを供給する処理ガス供給手段と、前記真空処理室内で処理される試料を保持する試料載置面を有する電極と、前記真空処理室を減圧する真空排気系とを有し、試料のエッティング処理を行うと共に該処理に伴う反応生成物を前記真空排気系で排出するエッティング装置において、

前記真空処理室内で前記試料載置面に對向する位置に配置され、前記処理ガス供給手段から供給される処理ガスを前記真空処理室に導入するための多数の孔を有するプレートと、

前記真空処理室の内壁の一部を構成する部材を100～250の範囲に加熱して前記反応生成物の堆積を抑制する加熱手段と、エッティング処理中にガス伝熱により前記部材を放熱する手段を備えた、

ことを特徴とするエッティング処理装置。

【請求項2】

真空処理室と、プラズマ発生装置と、前記真空処理室に処理ガスを供給する処理ガス供給手段と、前記真空処理室内で処理される試料を保持する試料載置面を有する電極と、前記真空処理室を減圧し試料のエッティング処理に伴う反応生成物を排出する真空排気系と、前記真空処理室の内壁の一部を構成する部材を100～250の範囲に加熱して前記反応生成物の堆積を抑制する加熱手段と、エッティング処理中にガス伝熱により前記部材を放熱する機能を備えたエッティング装置用のプレートであって、

前記プレートは、前記真空処理室内で前記試料載置面に對向しプラズマに面する位置に配置され、前記処理ガス供給手段から供給される処理ガスを前記真空処理室に導入するための多数の孔を有することを特徴とするエッティング処理装置用のプレート。